EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

06188555

PUBLICATION DATE

08-07-94

APPLICATION DATE

16-12-92

APPLICATION NUMBER

04334797

APPLICANT: FUJITSU LTD;

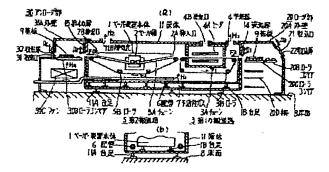
INVENTOR: IGUSA NOBUO;

INT.CL.

H05K 3/34 B23K 1/015

TITLE

VAPOR EQUIPMENT



ABSTRACT :

PURPOSE: To prevent the formation of oxide film by covering a vapor equipment proper with a cover, supplying an inactive gas to the cover and transferring substrates passing through a preheater and a vapor tank in an inactive gas atmosphere.

CONSTITUTION: After a substrate 9 is supplied through a feed-in inlet 2'l to a roller conveyor 20B of a loader part 20, it is put into a preheater 4 through a first transfer route 3, and the preheated substrate 9 is sent out through an inserting port 2A to a vapor tank 2 by a second transfer route 5. The solder is melted in the tank 2, the substrate 9 is discharged through the route 5 to a discharging port 2B and sent out a roller conveyor 30B of an unloader section 30, then the substrate 9 is took out from a taking-out outlet 31 after it is cooled by a fan 30C. Such consecutive processings are performed in an atmosphere of inactive gas 7 and the substrate 9 is not brought into contact with the outside air, so that the formation of oxide film in the soldering bonding part can be prevented.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

(19)日本園特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-188555

(43)公開日 平成6年(1994)7月8日

(51)Int.CL⁵

撤別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 K 3/34

T 7128-4E

B 2 3 K 1/015

D 8315-4E

審査請求 未請求 請求項の数5(全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特顯平4-334797

平成 4年(1992)12月16日

(71)出題人 000005223

富士通株式会社。

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 井草 延夫

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

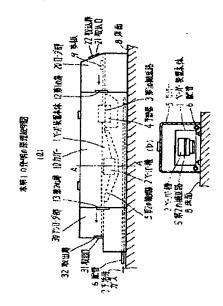
(74)代理人 弁理士 井桁 貞一

(54)【発明の名称】 ベーパー装置

(57)【要約】

【目的】 基板を加熱するベーバー樽を備え、該基板に 形成される半田が該ベーバー槽に於いて溶融れるように 形成されたベーバー装置に関し、酸化膜の形成を防ぐこ とで半田の接合品質の向上を図ることを目的とする。

【構成】 第1の搬送路によって予熱器に移送される基板が更に、第2の搬送路によってペーパー構に移送され、該基板を所定温度に加熱するペーパー装置本体と、床面に設置された該ペーパー装置本体を覆うカパーと、該カパーに所定圧力の不活性ガスの供給を行う配管とを備えると共に、開閉することで該第1の移送路に該基板の供給を行う第1の扉と、開閉することで該第2の搬送路から該基板の送出が行われる第2の扉とが該カパーに設けられ、該第1の扉から該第2の扉に移送される該基板の移送が該不活性ガスの雰囲気中に於いて行われるように構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の搬送路(3) によって予熱器(4) に移送される基板(9)が更に、第2の搬送路(5) によってベーパー楠(2) に移送され、該基板(9) を研定温度に加熱するベーパー装置本体(1) と、床面(8) に設置された該ベーパー装置本体(1) を覆うカバー(10)と、該カバー(10)に所定圧力の不活性ガス(7) の供給を行う配管(6)とを備えると共に、開閉することで該第1の移送路(3)に該基板(9) の供給を行う第1の扉(12)と、開閉することで該第2の搬送路(5) から該基板(9) の送出が行われる第2の扉(13)とが該カバー(10)に設けられ、該第1の移送が該不活性ガス(10)の雰囲気中に於いて行われることを特徴とするベーパー装置。

【請求項2】 第1の搬送路(3)によって予熱器(4)に移送される基板(9)が更に、第2の搬送路(5)によってベーパー標(2)に移送され、該基板(9)を所定温度に加熱するベーパー装置本体(1)と、該べーパー装置本体(1)を収納し、床面(8)に配股される筐体(11)と、該筐体(11)に所定圧力の不活性ガス(7)の供給を行う配管(6)とを備えると共に、開閉することで該第1の移送路(3)に該基板(9)の供給を行う第3の犀(14)と、開閉することで該第2の搬送路(5)から該基板(9)の送出が行われる第4の扉(15)とが該筐体(11)に股けられ、該第3の扉(14)から該第4の扉(15)に移送される該基板(9)の移送が該不活性ガス(7)の雰囲気中に於いて行われることを特徴とするベーパー装置。

【請求項3】 請求項1記載の前記第1の原(12)および 請求項2記載の前記第3の扉(14)を覆うように配設され、外気より遮断することで前記基板(9)を前記第1の 移送路(3)に供給するローダ部(20)と、前配第2の扉(1 3)および前記第4の扉(14)を覆うように配設され、前記 第2の搬送路(5)から送出された該基板(9)を外気より 遮断することで貯留するアンローダ部(30)とが設けられ ることを特徴とするペーパー装置。

【請求項4】 請求項3配載の前記ローダ部(20)の取込口(21)に取込扉(22)が散けられ、前記第1の扉(12)および前記第3の扉(14)の開放時には閉塞され、該第1の扉(12)および該第3の扉(14)の閉塞時には開閉自在となり、前記基板(9) の取込が行われると共に、前配アンローダ部(30)の取出口(31)に取出扉(32)が散けられ、前記第2の扉(13)および前記第4の扉(15)の開放時には閉塞され、該第2の扉(13)および前記第4の扉(15)の閉窓時には開閉自在となり、該基板(9)の取出が行われることを特徴とするベーバー装置。

【請求項5】 請求項1および請求項2記載の前記不活性ガス(7) の温度が常温より低く形成され、該不活性ガス(7) の供給が前記アンローダ部(30)を介して行われるよう前記配管(6) が該アンローダ部(30)に配設されることを特徴とするベーバー装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、基板を加熱するベーバー標を備え、核基板に形成される半田が該ベーバー槽に 於いて溶融れるように形成されたベーバー装置に関す る。

【0002】基板に電子部品を実装することで構成される電子機器は、通常、電子部品のリードが接合される基板のパッドにクリーム半田を譲布し、クリーム半田が付着されたパッドにリードを当接させ、ベーパー装置によって所定の温度に加熱させることでクリーム半田を熔触させ、半田によって所定のリードをパッドに接合することが行われる。

【0003】したがって、このようなベーパー装置には、基板を所定温度に加熱するベーパ槽が設けられ、基板の供給が行われることでパッドに施されたクリーム半田などの予備半田が溶融されるように形成されている。 【0004】

【従来の技術】従来は、図8の従来の側面断面図に示すように形成されていた。図8に示すように、ベーパー装置本体1 は、ヒータ4Aを内設し、ヒータ4Aの発熱が排気口4Aに送出されることで基板9を予熱する予熱器4 と、所定温度の蒸気を形成し、基板9を加熱するベーパー槽2 とがフレーム1Aに配設されることで形成され、予熱器4 にはローラ3Bの回転によってチエン3Aを矢印F1の方向に走行させる第1の搬送路3が、ベーパー槽2にはローラ5Bの回転によってチエン5Aを矢印F2の方向に走行させる第2の搬送路5がそれぞれ備えられている。

【0005】また、フレームIAには台足IBが設けられ、台足IBによってペーパー装置本体1が床面8 に設置されるように形成されている。そこで、フレームIAの一方に設けられた挿入台40に基板9 を裁置することで第1の機送路3 によって基板9 が予熱器4 を通過し、通常、100℃の予熱が行われ、次に、第2の搬送路5 によって基板9 がペーパー槽2 を通過することで155~215 ℃の加熱が行われ、フレームIAの他方に設けられた排出台41に排出される。

【0006】したがって、クリーム半田が塗布され、実装すべき部品が搭載された基板9を挿入台40に敷置することで、ベーパー槽2の加熱によりクリーム半田が溶融され、部品が基板9に半田付けされ、排出台41に排出されることになる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このよな予熱 器4と、ベーパー槽2とを配設することで基板9を移送 することでは、挿入台40から予熱器4を通過してベーパー槽2に連する間の加熱時、および、ベーパー槽2から 排出台41に連する間の冷却時に於いて、基板9が常温よ り高い温度に維持されることになり、特に、温度が70℃ 以上では飼材などの酸化は急速に進行するため、半田お よびその接合部が空気に触れることで酸化膜が形成されることになる。

【0008】したがって、酸化膜が形成されることで半 田接合が確実に行われなくなる問題を有していた。更 に、半円接合を確実にするために、例えば、フラックス の量を多くすることが考えられるが、フラックスの量を 多くすると、フラックスによる悪影響が生じると共に、 フラックスを除去する洗浄工数が増加し、好ましくな

【0009】そこで、本発明では、酸化膜の形成を防ぐことで半田の接合品質の向上を図ることを目的とする。 【0010】

【課題を解決するための手段】図1は本第1の発明の原 理説明図で、(a) は側面図, (b)は(a) のA-A 断面図,図 2は本第2の発明の原理説明図で、(a) は側面図,(b)は (a) のB-B 断面図である。

【0011】本第1の発明は、図1の(a)(b)に示すよう に、第1の搬送路3 によって予熱器4 に移送される基板 9 が更に、第2の搬送路5 によってベーバー槽2 に移送 され、該基板9 を所定温度に加熱するペーパー装置本体 1 と、床面8 に設置された該ベーバー装置本体1 を覆う カパー10と、該カパー10に所定圧力の不活性ガス7 の供 給を行う配管6とを備えると共に、期閉することで該第 1の移送路3 に該基板9 の供給を行う第1の扉12と、開 閉することで該第2の搬送路5 から該基板9 の送出が行 われる第2の扉13とが該カバー10に設けられ、該第1の 扉12から該第2の扉7 に移送される該基板9 の移送が該 不活性ガス10の雰囲気中に於いて行われるように、ま た、本第2の発明は、図2の(a)(b)に示すように、第1 の搬送路3によって予熱器4 に移送される基板9 が更 に、第2の搬送路5 によってペーパー槽2 に移送され、 該基板9を所定温度に加熱するペーパー装置本体1と、 該ペーパー装置本体1 を収納し、床面8 に配設される管 体11と、該筐体11に所定圧力の不活性ガス7の供給を行 う配管6とを備えると共に、開閉することで該第1の移 送路3 に該基板9 の供給を行う第3の属14と、開閉する ことで該第2の搬送路5から該基板9 の送出が行われる 第4の源15とが該篷体11に設けられ、該第3の扉14から 該第4の扉15に移送される該基板9 の移送が該不活性ガ ス7 の雰囲気中に於いて行われるように構成する。

【0012】更に、前配第1の扇12および前記第3の扇14を覆うように配設され、外気より遮断することで前記基板9を前記第1の移送路3に供給するローダ部20と、前記第2の扇13および前記第4の扇14を覆うように配設され、前記第2の搬送路5から送出された該基板9を外気より遮断することで貯留するアンローダ部30とが設けられるように、また、前配ローグ部20の取込口21に取込尿22が設けられ、前配第1の扇12および前配第3の扇14の閉窓時には閉塞され、該第1の扇12および該第3の扇14の閉窓時には開発され、該第1の扇12および該第3の扇14の閉窓時には開発され、前記基板9の取込が行

われると共に、前記アンローダ部30の取出口31に取出属32が設けられ、前記第2の原13および前記第4の原15の開放時には閉塞され、該第2の原13および前記第4の原15の開塞時には開閉自在となり、該基板9の取出が行われるように、また、前記不活性ガス7の退度が常温より低く形成され、該不活性ガス7の供給が前記アンローダ部30を介して行われるよう前記配管6が該アンローダ部30に配設されるように構成する。

[0013]

【作用】即ち、ベーパー装置本体をカパーまたは筐体によって覆い、カパーまたは筐体には不活性ガスの供給を行い、予熱器と、ベーパー槽とを通過する基板の移送が不活性ガスの雰囲気中に行われるようにしたものである。

【0014】また、カバーには第1と第2の扉を設け、 筺体には第3と第4の扉を設け、カバーおよび筺体の一 方には取込扉を有するローダ部を、他方には取出扉を有 するアンローダ部をそれぞれ設け、第1または第3の扉 が閉塞状態の時、取込扉が開閉自在になるようにし、第 2または第4の扉が閉塞状態の時、取出扉が開閉自在に なるようにすることで基板の取込および取出に際して、 基板が外気に触れることがないように形成されている。 【0015】更に、低温の不活性ガスの供給をアンロー ダ部に供給することで基板の冷却を促進させることが行 われる。したがって、取込扉から基板をローダ部に供給 することで半田付けされた基板はアンローダ部に排出さ れ、アンローダ部によって冷却後、取出扉を開放させる ことで基板の取出が行え、ローダ部に供給してからアン ローダ部に於いて取り出すまでの間は基板が完全に空気 に触れることのないようにすることができ、前述のよう な酸化膜の発生が防げ、半田接合の品質向上を図ること ができる。

[0016]

【実施例】以上本発明を図3〜図7を参考に詳細に説明する。図3は本第1の発明の一実施例の説明図で、(a) は側面断面図,(b) は要部断面図,図4は本第2の発明の一実施例の説明図で、(a) は側面断面図,(b) は要部断面図,図5は本発明の取込扉の開閉説明図で、図6は本発明の取出扉の開閉説明図、図7は本発明のアンローダ部の説明図で、(a)(b) は平面図である。全図を通じて、同一符号は同一対象物を示す。

【0017】本第1の発明は、図3の(a)(b)に示すように、基板9を100で程度に于熱する予熱器4と、予熱された基板9を155~215で程度に加熱するベーバー槽2とを内設し、台足1Bによって床面8に設置されたベーバー装置本体1の全体が覆われるカバー10を設け、ベーバー装置本体1の両側面に配管6を配設し、カバー10の内部には配管6によって窒素などの不活性ガス7を送出させ、カバー10の一方に設けられた矢印D1方向に開閉される第1の扉12が配設された側にはローダ部20を、他方に

設けられた矢印D2方向に開閉される第2の原13が配設された側にはアンローダ部30をそれぞれ備えるように構成したものである。

【0018】また、カバー10と、床面8 との当接部には パッキン10A が設けられ、カバー10の内部に送出された 不活性ガス7 が当接部から溺れ出すことのないようにす ることで配管6 から矢印HIのように送出された不活性ガス7 がカバー10の天井面に設けられた排気穴10B によっ て矢印H2方向に排出されるように形成されている。

【0019】この場合、不活性ガス7の圧力を30~40mm Ag程度にし、外気の気圧より高い値にすることで、カバー10の内部に外気が入り込むことがないようにする必要がある。

【0020】更に、ローダ部20は外気を遮断する外壁20 A と、外壁20A に内設されるローラコンベア20B と、20 C と、棚20D とによって構成され、外壁20A に形成された取込口21には矢印D3方向に開閉される取込扉22が設けられ、取込扉22が開放状態の時、基板9 の取り込みが取込口21によって行われる。

【0021】一方、アンローダ部30は外気を遮断する外壁30Aと、外壁30Aに内設されるローラコンベア30Bと、ファン30Cとによって構成され、ローラコンベア30Bに送出された基板9をファン30Cによって冷却すると共に、冷却後の基板9は外壁30Aに形成された取出口31によって取り出しが行えるよう矢印D4方向に開閉される取出原32が設けられている。

【0022】この場合、配管6によって送出される不活性ガス7の温度を常温より低く、例えば、5~10℃程度にし、矢印H11のようにアンローダ部30に送出させるようにすると、ファン30Cによる基板9の冷却がより効果的に行行われ、しかも、外気に触れることなく冷却が行われる。

【0023】また、本第2の発明は、図4の(a)(b)に示すように、基板9の予熱を行う予熱器4と、予熱された基板9を所定温度に加熱するペーパー検2とを備えた、ペーパー装置本体1を壁体11に収納し、壁体11が台足11Aによって床面8に設置され、ペーパー装置本体1の両側面には配管6を配設し、壁体11の内部には配管6によって窒素などによる不活性ガス7を送出させ、筺体の一方に設けられた矢印D1方向に開閉される第3の原14が配設された側にはローダ路20を、他方に設けられた矢印D2方向に開閉される第4の原15が配設された側にはアンローダ部30をそれぞれ備えるように構成したものである。

【0024】この場合、不活性ガス7の圧力を前途と同様に30~40mmAgにし、外気より高い値にすることで、配管6から矢印H1のように送出された不活性ガス7は筐体11の天井面に設けられた排気穴110から矢印H12方向に排出させ、筐体11の内部に外気が入り込むことがないようにする必要がある。

【0025】また、取込扉22には、図5の(a) に示すよ

うに、圧搾空気の送出される電磁バルブ23と25の開閉によって駆動されるシリンダ26と、スプリング28とが設けられ、電磁バルブ23または25の閉止時はスプリング28のバネ力によって取込口21が閉塞されるように、一方、第1の扉12または第3の扉14には電磁バルブ23の閉閉によって駆動されるシリンダ24と、スプリング27とを設け、電磁バルブ23の閉止時は、スプリング27のバネ力によって開放されるように形成されている。

【0026】そこで、電磁パルプ23が閉止状態の第1の 尿12または第3の原14が閉放状態の時は、取込尿22は開 閉が行われず、図5の(b) に示すように、電磁パルプ23 が閉放され、矢印E1およびE2のように圧力が加わること で第1の尿12または第3の尿14が閉放状態になった時、 始めて電磁パルプ25の開閉により取込尿22の開閉を行う ことができる。

【0027】したがって、取込扉22の開閉によって基板9の供給を行う際、第1の扉12および第3の扉14は必ず閉塞状態となるため、カバー10または筺体11の内部に外気が取り込まれることがないようにすることができる。【0028】更に、取出扉32には、図6の(a) に示すように、圧搾空気の送出される電磁バルブ33と35の開閉によって駆動されるシリング36と、スプリング38とが設けられ、電磁バルブ33または35の閉止時はスプリング38のバネカによって取出口31が閉塞されるように、一方、第2の扉13または第4の扉15には電磁バルブ33の開閉によって駆動されるシリンダ34と、スプリング37とを設け、電磁バルブ33の開止時は、スプリング37のバネカによっ

【0029】そこで、電磁パルプ33が閉止状態の第2の 原13または第4の屏15が開放状態の時は、取出原32は開 閉が行われず、図6の(b) に示すように、磁磁パルプ33 が開放され、矢印E11 およびE12 のように圧力が加わる ことで第2の屏13または第4の屏15が開放状態になった 時、始めて電磁パルプ35の開閉により取出扉32の開閉を 行うことができる。

て開放されるように形成されている。

【0030】したがって、取出原32の開閉によって基板9の取出を行う際、第2の雇13および第4の魔15は必ず開塞状態となるため、基板9の供給時と同様に、カバー10または筺体11の内部に外気が取り込まれることがないようにすることができる。

【0031】また、アンローダ部20では、ベーパー槽2を通過することで送出された基板9を極力貯留し、必要に応じて、基板9の取り出しが行えるように形成することが望ましい。

【0032】しかし、アンローダ部20のローラコンベア308 に単に基板9 を配列することでは、基板9 の貯留量には限界があるため、例えば、図7の(a) に示すように、2組のローラコンベア308 と、取出單32とを併設し、それぞれのローラコンベア308 には、第2の扉13または第4の扉から矢印FCのように送出される基板9 が配

列されるように形成すると、アンローダ部20の長さLを 大きくすることなく、基板9の貯留量を増加させること が行える。

【0033】また、図7の(b) に示すように、ローラコンペア30B に直交するローラコンペア30D を設け、第2の原13または第4の原から矢印FCのように送出される基板9を矢印FDのように配列されるようにすると更に、基板9の貯留量の増加が図れ、しかも、アンローダ部20の長さは前途のL より更に小さいL1に形成することができ、小形化を図ることができる。

【0034】したがって、取込口21から基板9をローダ部20のローラコンベア20Bに供給することで、基板9は矢印FAのように第1の鍛送路3によって千熱器4に取り込まれ、千熱器4によって千熱された基板9は挿入口2Aから第2の搬送路5によってベーバー槽2に送出され、ベーパー槽2によって半田の溶融が行われ、第2の搬送路5によって排出口2Bに排出され、矢印FBのようにアンローダ部30のローラコンベア30Bに送出され、ファン30による冷却後は、貯留されることになり、取出口31から取り出しが行われる。

【0035】このような取込口21から供給され、取出口31から取り出しが行われる間は、全て不活性ガス7の雰囲気中に行われることになり、基板9が外気に触れることがないため、前述のような半田接合部に酸化膜の形成が生じることを避けることができる。

[0036]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、ベーパー装置本体をカパーによって覆うか、または、筐体に収納し、不活性ガスを供給すると共に、カパーまたは筐体の一方にはローダ部を、他方にはアンローダ部をそれぞれ備え、基板の供給および取り出しに際しても、

カバーおよび筐体の内部に外気が侵入することがないようにし、基板の予熱、加熱、および、冷却時のペーパー 処理工程に於いて基板が全く、外気に触れることがない ようにすることができる。

【0037】したがって、従来のような半田接合部に酸化膜の形成することがなくなり、良好な半田接合が得られ、半田接合の品質向上が図れ、しかも、フラックスの使用を極力少なくすることができ、フラックスによる悪影響がなくなり、更に、フラックスの除去工数の削減が図れ、実用的効果は大である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本第1の発明の原理説明図
- 【図2】 本第2の発明の原理説明図
- 【図3】 本第1の発明による一実施例の説明図
- 【図4】 本第2の発明による一実施例の説明図
- 【図 5】 本発明の取込扉の開閉説明図
- 【図6】 本発明の取出扉の開閉説明図
- 【図7】 本発明のアンローダ部の説明図
- 【図8】 従来の側面断面図

【符号の説明】

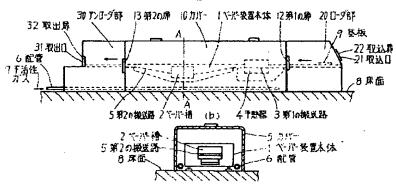
32 取出扉

| 1 | ベーパー装置本体 | 2 | ベーバー |
|----|----------|----|------|
| 3 | 第1の搬送路 | 4 | 经然代 |
| 5 | 第2の搬送路 | 6 | 配管 |
| 7 | 不活性ガス | 8 | 床面 |
| 9 | 基板 | 10 | カバー |
| 11 | 館体 | 12 | 第1の扉 |
| 13 | 第2の扉 | 14 | 第3の扉 |
| 15 | 第4の扉 | 20 | ローダ部 |
| 21 | 取込口 | 22 | 取込扉 |
| 30 | アンローダ部 | 31 | 取出口 |

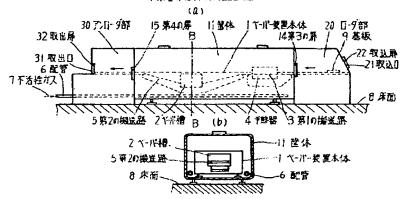
[図1]

本第一の発明の原理説明図

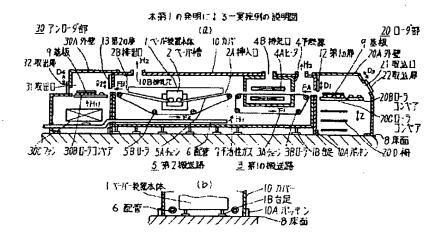
(2)

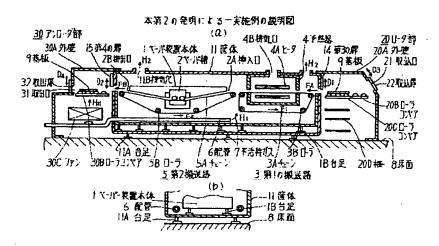


本第2の発明の原理説明図

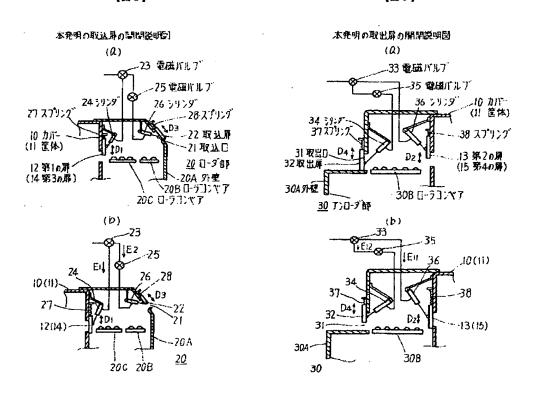


[図3]





[図5] [図6]



本発明のアンローダ部の説明図 (Q) 30 7:11-ダ部 308日・フコンア 37 取出扉 308日・フコンア 308日・フコンア (D) LI FC 13 第2 の扉 (15 第4 の扉) 308日・フコンア (10 カバー (11 産体) 3072日・ダ部 3072日・ダ部 3072日・ダ部

後来の側面新面図

[図8]

